

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертационной работе Максимова Максима Юрьевича на тему «Управление составом и свойствами никельсодержащих оксидных систем для твердотельных тонкопленочных аккумуляторов с использованием метода молекулярного наслаивания», представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по научной специальности 1.4.15. Химия твердого тела

Фамилия, имя, отчество	Маркеев Андрей Михайлович
Гражданство	РФ
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищается)	Доктор технических наук, 1.4.15 – Химия твердого тела
Ученое звание (по кафедре, специальности)	нет
Место работы:	
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, электронный адрес организации	141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9; https://old.mipt.ru/ , info@mipt.ru
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
Наименование подразделения	Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ)
Должность	Ведущий научный сотрудник
Публикации по специальности 1.4.15. Химия твердого тела	
1. Kozodaev, M.G., Lebedinskii Y.Y. , Zabrosaev I.V. , Volkov V.S., Markeev A.M.//Low-Energy He⁺ Ions Induced Functionalization of the MoS₂ Surface for ALD HfO₂ Growth Enhancement.- Journal of Physical Chemistry C.- 2023, 127(34).-P/17014–17020. 2. Koroleva A.A., Chernikova A.G., Chouprik A.A., Gornev E.S., Slavich A.S., Khakimov R.R., Korostylev E.V., Hwang C.S., Markeev A.M. Impact of the Atomic Layer-Deposited Ru Electrode Surface Morphology on Resistive Switching Properties of TaOx-Based Memory Structures // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2020. – Vol. 12, № 49. – P. 55331 – 55341. 3. Markeev, A.M., Kozodaev, M.G., Slavich, A.S., Romanov, R.I., Zarubin, S.S. Influence of reducing agent on properties of thin WS₂ nanosheets prepared by sulfurization of atomic layer-deposited WO₃ // Journal of Physical Chemistry C.-2020.- 124 (51), pp. 28169-28177. 4. Romanov, R.I., Kozodaev, M.G., Lebedinskii, Y.Y., Perevalov, T.V., Slavich, A.S., Hwang, C.S., Markeev, A.M. //Radical-Enhanced Atomic Layer Deposition of a Tungsten Oxide Film with the Tunable Oxygen Vacancy Concentration (2020) Journal of Physical Chemistry C, 124 (33), pp. 18156-18164. 5. Kozodaev M.G., Romanov R.I., Chernikova A.G., Markeev A.M. Atomic Layer Deposition of Ultrathin Tungsten Oxide Films from WH₂(Cp)₂ and Ozone // The Journal of Physical Chemistry C. – 2021. – Vol. 125, № 39. – P. 21663 – 21669.	

Официальный оппонент

Дата

Подпись

Маркеев Андрей Михайлович

ПОДПИСЬ РУКИ
ЗАВЕРЯЮ:
АДМИНИСТРАТОР КАНЦЕЛЯРИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА
О. А. КОРАБЛЕВА

